



이중 광빔 펨토초 광섬유 레이저

특허등록번호

10-1501509

특허명

이중 광빔 펨토초 광섬유 레이저

대표발명자

우주광학센터 이주형



이중 광빔 간 높은 수준의 상대주파수 안정도 확보 기술

빛을 이용하는 광기술은 대부분 산업 분야에 활용되며 그 성장은 2020년 8900억 달러에 달할 전망입니다. 동시에 함께 주목받는 것이 광섬유 레이저인데요. 광섬유 레이저 기술을 뒷받침 할 KRISS 신기술 '이중 광빔 펨토초 광섬유 레이저'를 소개합니다.

해당 기술은 기존 이중 광빔 생성을 위해 두 대의 펨토초 레이저를 사용한 것과 달리 단일 펨토초 레이저를 사용하기 때문에 시스템이 간단합니다. 또한 이중 광빔 간 높은 수준의 상대 주파수 안정도를 확보할 수 있는 장점이 있습니다.

초정밀분광, 정밀 장거리 측정 등 산업, 의료, 국방 등 여러 분야에 응용·적용될 수 있는 KRISS의 기술을 만나보세요!

